

## Spritzgiess-Einsatz: Spezifikationen

- Minimale Strukturgrösse > 70nm
- Strukturhöhe / Uniformität = 50nm - 50µm / 3 – 5 %
- EXKLUSIV: einstellbarer Mikrostruktur-Flankenwinkel bis zu 15°
- Herstellung gemäss angepasstem LiGA-Verfahren
- Mehrlagige Struktur-Architekturen möglich (micro+nano)
- Richtgenauigkeit Lage-zu-Lage ≤ 3 µm
- Richtgenauigkeit Mikrostruktur zur Einsatz-Geometrie ≤ 20 µm
- Typ. Dickenbereich des Einsatzes : 3 - 8 mm
- Maximale Einsatz Dimensionen = 300 x 300mm
- Maximale strukturierte Fläche = 200 x 200mm
- Parallelität Frontseite-zu-Rückseite ≤ 10 µm (Rückseite geschliffen)
- Robustes Handling möglich
- Einbau-fertiger Einsatz gemäss Kundenzeichnungen
- Kontouren drahterodiert (Toleranz = +/-10µm)
- Kompatibilität zu Diamant-Bearbeitung
- Optional: Antihalt-Beschichtung (Fluor-basierend)
- Optional: Verschleiss-Schutz Beschichtung (z.B. TiN)
- Kompatibilität zu allen gängigen Strukturierungsmethoden:
  - e-beam Resiste (PMMA, HSQ)
  - XIL- Resiste
  - UV-Lithographie Positiv-ton Resiste, SU-8
  - Heissgeprägte Polymers, Thermal imprinting,...